Cu₂SnS₃薄膜の発光スペクトルの観測

Observation of photoluminescence spectra from Cu₂SnS₃ thin films 後藤祐輔⁽¹⁾,田中久仁彦⁽¹⁾,打木久雄⁽¹⁾,粟飯原直也⁽²⁾,荒木秀明^(2,3) (1)長岡技術科学大学,(2)長岡工業高等専門学校,(3)独立行政法人科学技術振興機構さきがけ Yusuke Goto⁽¹⁾, Kunihiko Tanaka⁽¹⁾, Hisao Uchiki⁽¹⁾, Naoya Aihara⁽²⁾, Hideaki Araki⁽²⁾⁽³⁾ (1) Nagaoka University of Technology (2)Nagaoka National College of Technology (3) PRESTO, Japan Science and Technology Agency

> Abstract Cu_2SnS_3 (CTS) is expected to be a material for the p-type absorber layer of thin film solar cell. It has been reported that the electric and photovoltaic properties of CTS thin films depend on the Cu / Sn ratio. In order to elucidate the cause of this dependence, photoluminescence (PL) dependence of CTS thin films on Cu/Sn ratio was investigated. Cu poor or stoichiometric sample showed PL at 0.95 eV but Cu rich sample and the PL tended to become stronger with increase in temperature.

1. はじめに

 Cu_2SnS_3 (CTS) は p 型半導体で、その構成要素が地殻中に豊富に存在するため安価であり、いずれも毒性を持たないという特徴を持っている.また光吸収係数が 1.0×10^4 cm⁻¹台と太陽電池の光吸収層に適した特徴も持っている.これまで CTS を光吸収層とした太陽電池において 2.92%の変換効率が報告されている¹⁾. その報告では発電効率に Cu/Sn 組成比依存があり Cu/Sn<2.0、つまり Cu poor にすると発電効率が改善されると報告されている.これは Cu 空孔 (V_{cu}) による欠陥準位が効率改善に寄与している可能性を示している.しかし V_{cu} などの CTS の欠陥や不純物に関する報告は少なく詳細は分かっていない. CTS の太陽電池の発電効率改善のためには、特性を早急に明らかにする必要がある.そのためには欠陥準位や不純物準位に敏感な発光の観測を行うことが有効である.

本報告では、電子ビーム蒸着法により作製した組成の異なる 3 種類の CTS 薄膜の フォトルミネッセンス (PL) の観測結果を報告する.

2. 実験方法

サンプルは Cu poor, 化学量論比組成, Cu rich の3種類とした. サンプルの組成を Table 1 に示す. 具体的な作製条件は次の通りである. 電子ビーム蒸着法によりソーダ ライムガラス基板上に Cu/Sn 合金薄膜を堆積し, プリカーサを作製した. ターゲット には Cu/Sn 組成比の異なる Cu-Sn 合金を用いた. 蒸着条件は成膜圧力 6.0×10⁴ Pa 以下, 基板加熱温度 150 ℃ とした. 得られたプリカーサを硫黄 (99.9999%) 100 mg と共にガ ラスコンテナへ入れ, 電気炉中の石英管に置き, 加熱することで硫化し, CTS 薄膜を 作製した. 硫化の際は真空引きをせずに窒素パージ後, 室温から昇温速度 10 ℃/min, 保持温度 560 ℃, 保持時間 2 時間, 窒素ガス流量 20 sccm とした. 加熱後は 2 時間自 然冷却した.

Sample name	Cu/Sn S/Metal		
Cu poor	1.77	1.03	
Stoichiometry	2.00	1.01	
Cu rich	2.21	0.99	

Table 1 Chemical composition ratio of samples

サンプルの励起には Nd³⁺:YVO₄ レーザーの第二高調波 (CW, 波長 532 nm, 励起 強度 1000 mW/cm²) を用いた. サンプル温度はクライオスタットに取り付け 14-300 K に, また, ホットプレートに取り付け 300-443 K の範囲で変化させた. 試料からの 発光は焦点距離 30 mm のポリクロメータで分光し, InGaAs リニアダイオードアレイ で検出した.

3. 結果および考察

作製した CTS 薄膜の PL の温度特性を Fig.1 に示す. 観測温度範囲は 13-473 K で ある. Fig. 1 より Cu poor と Stoichiometry \mathcal{O} サンプルではピークエネルギーは確認でき ないものの低エネルギー側にブロードな発 光および,約0.95 eV にピークを持つ高エネ ルギー側の発光の2つの発光を確認するこ とができた. 一方 Cu rich のサンプルでは, はっきりとした発光はないことが分かる. なお,いずれのサンプルでも443K で観測さ れている低エネルギー側で強度が強くなる 発光は黒体放射によるもので CTS 薄膜に起 因するものではない. Cu poor と Stoichiometry のサンプルのみに発光が見ら れることから,これらの発光は Cu 空孔に起 因すると推測できる.温度依存性を見ると, 2 つのピークのうち低エネルギー側のピー クは温度上昇と共に発光強度が弱くなって いる.また,発光の裾が拡がっているため 複数のピークがある可能性がある. 高エネ ルギー側のピークは約 0.95eV であり CTS のバンドギャップは報告¹⁾より 0.97eV 程度 のため、この発光の起源としては伝導帯-ア



Fig.1 PL emission intensity

クセプタ準位間発光,ドナー-アクセプタ再結合発光,ドナー - 価電子帯間発光の 3 種類が推測できる.発光起源がこれらのどれに対応するのかを知るためには励起強度 依存性や時間分解分光を行う必要がある.この 0.95 eV の発光は温度上昇と共に発光 強度が強くなりその後弱くなるという傾向を示し ている.通常,半導体のPLは温度上昇と共に弱く なる.しかし,0.95 eVのピークの傾向はこれと一 致していない.この原因としては近接する欠陥準 位から熱励起によりキャリアが励起され発光に寄 与するキャリアの再結合が増えたからと推測した. そこで論文²⁾より Fig.2に示すようなFからGへ の熱励起プロセスがある発光を考え,式(1)のよう にモデル化しフィッティングを試みた.

$$\frac{\partial}{\partial t}A_{(t,T)} = A^{(0)} + A^{(1)} + A^{(2)} + A^{(3)} \tag{1}$$

ここで*A*⁽⁰⁾はFより高エネルギーの準位からFへの遷移,*A*⁽¹⁾はFからの放射再結合,*A*⁽²⁾はFからの 非放射再結合,*A*⁽³⁾はFへの熱励起を表している.こ れより発光強度*I*(*T*)は式(2)のように求められる.

$$I(T) = I(0) \frac{\left\{1 + D_1 exp\left(\frac{-E'_1}{k_b T}\right)\right\}}{\left\{1 + C_1 exp\left(\frac{-E_1}{k_b T}\right)\right\}}$$
(2)

Fig.2 Fitting model



of the PL emission intensity

ここで E'₁は熱励起の活性化エネルギーE₁は非放 射再結合の活性化エネルギーである. Cu poor, Stoichiometry の発光に対して(2)式の フィッティングを行った. なお,発光スペクトルの発光強度の導出は以下のように行 った. ①ピークの両端の 10 点を直線近似②近似した直線を全体から引く③残ったピ ークを積分する. プロットした観測データとフィッティング結果を Fig.3 に示す. フ ィッティングに使ったパラメータを Table 2 に示す。

81						
	<i>I</i> (0)	D_1	<i>E</i> ' ₁ (meV)	C_1	$E_1 (\mathrm{meV})$	
Cu poor	8.3	1.9×10^{6}	55.8	1.6×10^{11}	971.8	
Stoichiometry	4.2×10^{5}	47.8	48.1	2.2×10^{6}	424.9	

Table 2 Fitting parameters

E'1はどちらのサンプルも数十 meV 程度であった. どちらのサンプルも発光が最大になる温度は室温 (300 K = 26 meV) 程度であり,発光強度と活性化エネルギーの関係としては妥当な値が得られた.しかし, E'1はどちらのサンプルも数百 meV と算出された.非放射再結合の活性化エネルギーはフォノン放出による再結合 (Fig.4) と,発光が伝導帯からアクセプタレベルへの遷移,あるいはドナーレベルからアクセプタレベルへの遷移であれば価電子帯からアクセプタレベルの熱励起による発光の減少

(Fig.5) が考えられる.フォノン放出による非放射再 結合は Fig.4 に示すように基底状態と励起状態の電 子のエネルギーが配位座標上で交差している場合 に起こり, 図中の a→b→c の順で遷移する. この場 合活性化エネルギーは Fig.4 に示す E1 になるが,バ ンドギャップ 0.95 eV に対し活性化エネルギーが数 百 meV になることは考えられない. また、熱励起 による発光の減少は Fig.5 に示すように、価電子帯 にある電子が熱励起によりアクセプタ準位に励起 されることにより、上準位からアクセプタレベルへ 緩和する際の放射再結合が減ることにより起こる. この場合の活性化エネルギーは価電子帯からアク セプタレベルへの熱励起エネルギーである. CTS のバンドギャップが 0.97 eV であり 0.95 eV 発光が 観測されているのでこの値が数百 meV であるとは 考えられない.

以上のように、フィッティングにより得られた 活性化エネルギーで発光強度の温度依存性を説明 することができなかった.これは発光強度を算出す る際の方法に問題があったためと推測している.今 後は発光強度の算出方法の検討ならびに、今回観測

した以外の組成比での発光スペクトルの検討を行っていく予定である.



Fig.4 Configuration coordinates model



Fig.5 Thermal excitation model

4. 結論

CTS の欠陥準位を考察するために PL の観測を行った. その結果 0.79 eV より低い エネルギーにピークを持つ発光と 0.95 eV 付近にピークを持つ発光を観測した. 0.95 eV にピークを持つ発光は温度上昇と共に発光が強くなるため,熱励起のプロセスを 含む発光であると仮定しフィッティングを行った.しかし妥当な非放射再結合の活性 化エネルギーを求めることはできなかった.

謝辞 本研究の一部は JST 戦略的創造研究推進事業さきがけの一環として行われた ものである.

参考文献

- 1) N.Aihara et al., 18th ICTMC, P08-P02(2012).
- 2) Hajime Shibata, Jpn. J. Appl. Phys. **37** (1998) 550-553.